

日本全国1,000台以上の研究設備・機器の利用と総合的な支援が可能です。

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

全国25法人のネットワークがニッポンの「モノづくり」を応援します。

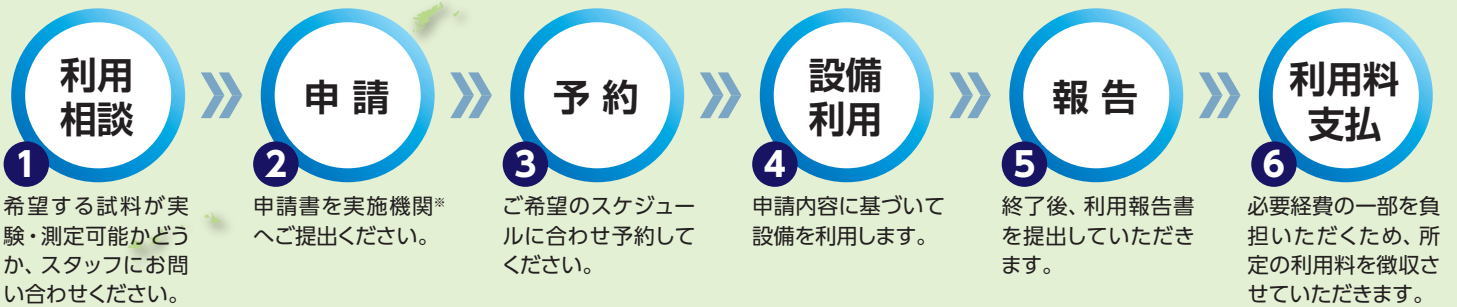


最先端装置の共用

経験豊富な研究者の知見

専門スタッフによる高度な技術支援

●利用の流れ



●サポート内容

技術相談	技術的な問題解決について、各機関のスタッフがさまざまなご相談に対応します。	機器利用	利用者の方がご自身で機器を操作し、実験をします。データの解析や考察は利用者が行います。	技術補助	操作方法などについて、利用者がスタッフの指導・補助を受けながら、機器を使用します。
技術代行	依頼に基づいて実験・測定・評価・解析をスタッフが代行します。	共同研究	データの解析や学術的な議論を含めて、利用者と実施機関*が共同で行います。		

*実施機関…ナノテクノロジープラットフォームを構成する大学等37組織

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

センター機関

国立研究開発法人物質・材料研究機構 ナノテクノロジープラットフォームセンター
TEL : 029-859-2777 E-Mail : NTJ_info@nanonet.go.jp
<https://www.nanonet.go.jp/>



NanotechJapan

クイックアクセスで簡単お問い合わせ!



https://www.nanonet.go.jp/yp/

ナノテクジャパンは、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム」事業「ナノテクノロジープラットフォーム」事業の共同利用施設による課題解決の加速

クイックアクセス

研究開発のアイデアはあるが、どう実施したらよいか分からない
研究開発の実施にリスクが伴うので、専門家と相談しながら進めたい
研究開発の局面を最先端装置の利用で打開したい
最先端装置の利用により効率的に研究成果を上げたい

最先端研究設備全般について、あるいは大型共用施設の利用案内などについても、お気軽にお問い合わせください。

【禁止事項】 お問い合わせの際、次の行為をしてはならないものとします。
1. 他人のメールアドレスを登録する等、虚偽の申告、届出を行なう行為。
2. 営業活動もしくは登録を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
3. 第三者もしくは当センターの名称もしくは信用を毀損する行為。
4. コンピュータウイルス等、有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそのおそれのある行為。

ダウンロード
パンフレット/Pamphlet
リーフレット/Leaflet
ビデオ/Video

最新情報 What's New --- 詳しくはこちら

秀 平成30年度 での利用成果 「秀でた利用成果」5件が決定!! 受賞課題はこちら
文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム

ナノテクニュース Nanotech News
メールマガジン 購読者募集中!
購読希望の方は こちらから お問い合わせください

NanotechJapan Nanotechnology Platform

ナノテクジャパンメールマガジンのご案内

ナノテクノロジープラットフォームセンターでは、ナノテク最新情報を電子メールでお知らせする、「ナノテクジャパンニュース」を無料で、隔週配信しています。是非、ご登録ください。

申込みは、メールアドレス登録のみ!

※個人情報の取り扱い
ご登録いただいた個人情報(メールアドレス)は、ナノテクノロジープラットフォームプライバシーポリシーに則り、適正にお取り扱い致します。また、メールマガジン配信以外の目的には使用致しません。



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム「利用報告書」記載例

(記入例)

課題番号 (Application Number) : F-16-NM-1234
 利用形態 (Type of Service) : 機器利用 (重複する場合は、主な形態を1つ記入してください。)
 /Describe only one type of service)
 利用課題名 (日本語) : ○○○○○○○○
 Program Title (English) : ○○○○○○○○
 利用者名 (日本語) : ○○○○1), △△△△2) (課題申請者はアンダーライン)
 Username (English) : A. Aaaa1), B. Bbbb2) (Underline the name of the applicant)
 所属名 (日本語) : 1) ○○大学大学院△△研究科, 2) ○○株式会社
 Affiliation (English) : 1) △△, ○○University, 2) ○○, Co., Ltd.

1. 概要 (Summary)

(技術相談の場合は、概要のみの記載でも構いません。)
 (例) JEM-ARM200Fにおいて、材料の高温観察をProtochips社製Aduro型加熱ホルダーを用いてHRTEMその場観察を行い、成長膜の高温での構造変化を解析する。

2. 実験 (Experimental)

(利用した主な装置の名称と、実験方法などを記載してください。)
 (例) 試料はレーザーアブレーション法によってエピ成長させたSS膜であり、これをFIBにてピックアップした断面薄片試料をProtochips社製Aduro型高温加熱チップ観察窓膜上に取り付けた。これをARM200Fにて高温HRTEM観察を行った。観察温度は500℃～1000℃であった。
 利用装置:
 ・電子顕微鏡試料作製装置群(FIB等)
 ・実動環境対応物理分析TEM(JEM-ARM200F)

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

(図表は必要に応じて記載してください。)
 (例) 温度800℃以上になるとエピ成長したSS膜は、-----となった。膜の変化部分の構造はHRTEMおよびSTEM-Diffractionイメージングにより詳細に解析され、****というような構造をとっていることが提案された。またSTEM-EDSによる組成が定量解析され、提案された構造に矛盾しない組成になっていることがわかった。

4. その他・特記事項 (Others)

(参考文献や用語説明の他、謝辞として、競争的資金名、共同研究の共同研究者名、あるいは支援に対応した技術支援者名等を必要に応じて記載してください。特段の記載事項がなければ、「なし。」と記載してください。)
 (例) 支援者: 材料 研、尾西幸三、M.nano

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

(該当がなければ、「なし。」と記載してください。)
 (例) 物質一郎, 材料二郎,
 「*****に関する研究」第○○回応用物理学関係
 連合講演会(口頭発表) **年*月

6. 関連特許 (Patent)

(公開もしくは登録となったものについて記載し、公開前のものは記載しないでください。該当がなければ、「なし。」と記載してください。)
 (例) なし

知財取扱

知的財産権の取り扱いについては、実施機関*との取り決めに拠ります。成果非公開を希望する利用者は、本事業とは別に、実施機関*が独自に行う設備共用の申し込みをすることができます。

公開猶予

本事業の成果は公開が原則ですが特許申請等の理由で利用者が公開時期の延期を希望する場合は、成果公開(利用報告書提出)を最大2年間延期できます。

※実施機関…ナノテクノロジープラットフォームを構成する大学等37組織

ナノテクノロジープラットフォーム

微細構造解析プラットフォーム



【主要研究設備】マルチビーム超高圧電子顕微鏡、収差補正分析電子顕微鏡、単原子分析電子顕微鏡、陽電子プロブマイクロアナライザー装置、軽元素対応型超高分解能走査透過型電子顕微鏡、反応科学走査透過電子顕微鏡、極低温高分解能透過電子顕微鏡、超高圧電子顕微鏡、SPRING-8放射光源ビームライン、電子分光型超高圧電子顕微鏡

微細加工プラットフォーム



【主要研究設備】電子ビーム露光装置、ステッパー、RIE (Reactive Ion Etching) 装置、CVD装置、収束イオンビーム装置、レーザー加工装置、膜特性計測・分析装置、形状計測装置、表面計測装置(SEM等)

分子・物質合成プラットフォーム



【主要研究設備】核磁気共鳴装置、光分析装置、質量分析・その他材料評価、バイオ用光学顕微鏡、バイオ評価、真空成膜装置や薄膜/ナノ調製加工、化学材料合成・素子作成、バイオ調製、透過型電子顕微鏡、表面分析(走査電子顕微鏡/ EDX / EPMA、電子分光(XPS / UPS / AES)、X線回折装置、走査型トンネル顕微鏡、原子間力顕微鏡